

定制聚四氟乙烯方形槽 半导体浸泡清洗耐酸含氟聚合物过滤容器

货号: PL-CP53



简介

我们的定制聚四氟乙烯方形槽可最大化提升半导体制造效率，专为优异耐酸性和痕量分析纯度设计。这些高性能含氟聚合物容器可确保无污染浸泡，满足当今严苛实验室与工业流程对化学品处理的可靠性要求。

了解更多

应用	说明	核心优势
半导体晶圆蚀刻	将硅晶圆浸入浓酸浴中进行表面改性和污染物去除。	防止金属离子污染，耐受强氢氟酸/硝酸混合溶液。
太阳能电池加工	大规模光伏生产线中硅衬底的结构化处理与清洗。	大批量加工耐用性出色，耐受碱性蚀刻溶液。
痕量分析样品制备	实验室容器的酸溶解与浸泡，确保零污染基线。	超低浸出率满足皮克级检测限要求。
贵金属回收	作为反应或浸泡容器，用于王水或氰化物溶液溶解金属。	完全耐受氧化腐蚀，高温稳定性优异。
航空航天部件清洗	使用腐蚀性化学试剂对高精度发动机部件进行脱脂除垢。	在高负荷严苛工业环境下可长期稳定运行。
制药化学合成	作为高纯药品生产中腐蚀性试剂处理的主容器。	符合FDA要求，不粘表面便于灭菌。
电池研发与测试	将电极材料浸泡在电解液中进行加速老化和性能测试。	与各类锂盐和有机碳酸盐具备化学兼容性。
微电子光刻胶剥离	在高温下使用专用溶剂混合物去除衬底上的有机涂层。	在热应力和溶剂接触下仍能保持结构完整性。

参数	PL-CP53规格
基础材料	100%全新料高密度聚四氟乙烯 (PTFE)
可选材料	全氟烷氧基树脂 (PFA)，可提升透明度或化学纯度
尺寸 (长×宽×高)	完全可定制 (适配客户 workspace 和批次大小)
壁厚范围	可定制 (根据容积，标准为5mm至30mm以上)
工作温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
化学兼容性	通用兼容 (熔融碱金属和部分氟化剂除外)
制造工艺	五轴CNC加工/高精度焊接 (按需选择)
内部配置	可定制挡板、过滤槽和分层支架
排水系统	可选集成聚四氟乙烯球阀或NPT螺纹接口
盖子配置	提供松配式、螺栓固定式或铰链式聚四氟乙烯盖
表面处理	加工光滑 (可按需提供Ra < 0.8 μm粗糙度)
负载能力	根据特定材料密度和容积设计